

# 利用登録状況 (入退室システム登録者数 令和4年3月末時点)

## 教員(研究員を含む) と学生のみを抽出

学系	研究室名	教員	学生	総計	
電気電子工学	半導体工学	3	19	22	81
	電子デバイス工学	3	15	18	
	電子物性工学	1	10	11	
	光エレクトロニクス	2	15	17	
	光エンジニアリング	1	2	3	
	先進センシング工学	1	1	2	
	応用物質科学	3	5	8	
材料化学	高分子物理学	3	12	15	35
	高分子物性工学	1	1	2	
	高分子フォトンクス	1		1	
	応用高分子化学	1		1	
	アモルファス工学	1		1	
	機能高分子設計	1	10	11	
	ナノ物性化学	1	3	4	
機械工学	輸送現象制御学	1	5	6	11
	機能表面加工学	1		1	
	先端材料学	2	2	4	
	合計	27	100	127	

# 月別装置稼働時間 (令和3年度)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
MIKASA アライナ	4.0	12.0	54.5	46.0	29.0	18.0	32.0	23.0	6.0	26.5	9.0	8.5	268.5
両面マスクアライナ	3.5		1.0				8.0	7.5					20.0
キャノン アライナ													0.0
スプレーコーター													0.0
有機ドラフト	25.3	21.0	50.8	49.5	44.5	34.0	49.0	45.5	25.0	37.5	14.0	25.5	421.5
RFスパッタ装置													0.0
電子ビーム蒸着装置													0.0
LL式電子ビーム蒸着装置			4.5	6.5		2.5	1.0	14.0	19.0	29.5			77.0
実験用熱蒸着装置													0.0
TEOS-CVD装置	3.5	14.5	21.0	11.5	11.3	7.5	14.5	6.5		6.0			96.3
Siディープエッチング装置		6.7	13.7					8.8	9.0	3.0	8.5	10.0	59.7
化合物半導体エッチング装置								3.0	2.0				5.0
簡易プラズマ処理装置	14.8	1.0		2.0	4.5	3.0	2.0	14.3	36.5	5.0	2.5	1.0	86.5
酸ドラフト	7.5	14.5	10.0	7.5	2.0	3.5	10.0	18.5	1.0	20.0		9.0	103.5
熱処理炉													0.0
急速アニール炉	1.0	9.5	8.5	5.0	3.0		5.0			4.5			36.5
小型拡散炉													0.0
電界放出型高分解能走査電子顕微鏡	63.0	49.8	35.8	67.3	21.8	22.5	59.3	63.8	59.8	42.5	15.3	12.5	513.0
段差膜厚計	34.8	12.1	39.4	26.9	13.0	18.8	42.0	62.3	70.1	33.8	15.0	18.3	386.3
レーザー顕微鏡	0.5					1.0	6.5				0.5		8.5
卓上SEM (EDX)	12.5	16.3	36.2	28.0	21.5	8.0	36.5	21.5	15.0	16.0	7.0	5.8	224.2
X線光電子分光装置	8.0	5.0	7.0		7.5	58.0	27.5	55.5	25.0	44.5		16.0	254.0
高精度X線回析装置	318.0	320.5	284.0	257.0	177.5	187.0	292.5	268.5	169.3	191.5	92.5	108.0	2666.3
	496.3	482.8	566.3	507.2	335.5	363.7	585.8	612.6	437.7	460.3	164.3	214.5	5226.9